оз Графеновые суспензии для 2D-печати

© Р.А. Соотс¹, Е.А. Якимчук¹, Н.А. Небогатикова¹, И.А. Котин¹, И.В. Антонова^{1,2}

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

 2 Новосибирский государственный университет E-mail: nadonebo@gmail.com

Поступило в Редакцию 29 октября 2015 г.

Показано, что обработка суспензии графита на основе этанола или воды ультразвуком в сочетании с центрифугированием позволяет получить частицы с толщиной до 1–6 nm, а в наиболее интересных случаях до 1–1.5 nm. Аналогичная обработка суспензии графита на основе органического растворителя дает в конечном итоге более толстые частицы (до 6–10 nm), даже при более продолжительной обработке. При помощи 2D-печати чернилами на основе графена и этанола с добавлением этилцеллюлозы и терпинеола получены тонкие пленки (~ 5 nm) со слоевым сопротивлением после отжига ~ 30 МΩ/ \square . В случае чернил, полученных из суспензии графена на водной основе, слоевое сопротивление составило ~ 5–12 kΩ/ \square для пленок толщиной 6–15 nm, а подвижность носителей ~ 30–50 cm²/(V · s).

В настоящее время 2D-печатные технологии получения приборных устройств являются важным направлением развития современной электроники и фотоники [1,2]. Наиболее привлекательными чертами данного направления являются низкая себестоимость технологического процесса, возможность создавать приборные устройства на гибких подложках и гибридный подход с использованием органических материалов. Появление графена и других 2D-материалов с их уникальными свойствами дает надежду на существенное улучшение качества материалов, используемых для печати, на появление новых важных и перспективных материалов для печати, на значительное улучшение свойств и расширение спектра приложений печатных технологий [3].

Основными требованиями, предъявляемыми к графеновой суспензии при использовании ее для 2D-печати, являются проводимость, латеральные размеры и толщины частиц суспензии. Толщина частиц должна быть не более нескольких нанометров, а латеральные размеры

102

должны быть примерно в 50 раз меньше диаметра сопла [1,2]. При диаметре сопла 20 μ m это соответствует размерам \leq 400 nm. Не менее важным является сохранение проводимости частиц после их измельчения. Известно, что в процессе расслоения и измельчения частиц может происходить их окисление и появление в них дефектов [4,5]. Оба этих процесса будут сказываться на проводимости получаемых слоев. Кроме того, использование органических добавок (например, этилцеллюлозы для стабилизации суспензии и терпинеола для обеспечения необходимой вязкости) требует дополнительного отжига для их удаления и обеспечения функциональных свойств напечатанных слоев. Типичные значения сопротивления напечатанных слоев из чернил на основе графена лежат в диапазоне от $700 \,\Omega/\Box$ до нескольких сотен $k\Omega/\Box$ [1,6]. В работе [7] была продемонстрирована возможность получать суспензию графена с использованием электрохимического процесса для расслоения и разделения графита на относительно мелкие частицы без его окисления.

В данной работе реализован достаточно простой способ получения суспензии графена для 2D-печати с использованием электрохимического расслоения графита, созданием суспензий на основе этилового спирта (этанола) и/или воды с применением ультразвуковой обработки и центрифугирования. Для сравнения была также получена суспензия графена в органическом растворителе N-метилпирролидоне (NMP, C₅H₉NO). Обнаружено, что расслоение частиц прошло наиболее эффективно в водных и спиртовых растворах. Проводимость частиц мультиграфена при этом осталась достаточно высокой $5-12 \, k\Omega/\Box$, что позволило получить нанометровые проводящие слои.

При электрохимическом расслоении графита мы использовали электролит на основе водного раствора персульфата аммония $(NH_4)_2S_2O_8$. Расслаиваемый графит (высокоориентированный пиролитический графит (HOPG) или природный графит) использовался в качестве анода. Процесс расслоения основан на образовании пузырьков газа на поверхности анода, в результате чего электролиз в течение нескольких минут позволял расслоить HOPG и получить раствор с графитовыми частичками разной толщины (менее 100 nm) и латеральными размерами несколько микрон (менее 5μ m). В отличие от обычного способа химического расщепления порошка графита и получения графеновой суспензии, включающего в себя использование органических растворителей и многочасовые обработки ультразвуком, электролиз за несколько



Рис. 1. АСМ-изображения поверхности SiO₂/Si с нанесенной на нее графеновой суспензией: (a - cpasy после электрохимического расслоения графита, b, c - после трех циклов 30 min обработки ультразвуком и 30 min центрифугирования для суспензий на основе спирта (b) и NMP (c). Вставки — рельеф поверхности, позволяющий оценить толщину и размеры частиц суспензии. Атомно-силовая микроскопия проводилась с использованием установки Solver PRO NT-MDT.



минут дает примерно такой же результат и, что особенно важно, без применения органических добавок. Изображение частиц суспензии, полученной электрохимическим расслоением, приведено на рис. 1, *a*, где промытые от раствора частички нанесены на поверхность SiO₂/Si с толщиной окисла 300 nm. Измерения с использованием атомно-силового микроскопа (ACM) показали, что толщина частиц варьируется от нескольких нанометров до нескольких десятков нанометров. Измерение сопротивления пленок на подложках SiO₂/Si дало значение ~ $20 \Omega/\Box$ для пленки толщиной около 100 nm. Измерения с использованием четырехзондовой головки Jandel (расстояние между зондами ~ 1 mm), т. е. сопротивление усреднялось по большой площади.

Частицы, полученные электрохимическим расслоением, после промывки и фильтрации были перенесены в другие растворы. В первом случае частицы были смешаны с NMP, NMP — органический растворитель, который широко используется для получения графеновой суспензии

и который, как считается, дает максимальный выход монослойных частиц графена [8]. В других случаях была приготовлена суспензия графита на основе воды и этанола со специальными добавками. Затем все типы суспензий были подвергнуты трем циклам обработки относительно слабым ультразвуком (180 W, 30 min) в сочетании с центрифугированием (10 000 rpm, 30 min). Полученные после такой обработки суспензии наносились на подложку SiO₂/Si (рис. 1, b, c). Рельеф поверхности частиц из разных суспензий, показанный на вставках рис. 1, b, c, позволяет сделать оценку толщин частиц, полученных суспензий. Видно, что для суспензии в NMP толщина частиц составляет 6-20 nm, тогда как для суспензии в растворе этанола толщина частиц существенно меньше — она варьируется от монослоя ($\sim 0.4\,\mathrm{nm}$) до 1-1.5 nm. В водной суспензии толщина частиц варьировалась от 0.4 до 6-12 nm. Латеральные размеры во всех случаях были близкими (~ 100 nm). Полученные из суспензий графена на водной и спиртовой основе относительно толстые слои (100-200 nm) имели сопротивление 170-210 Ω/□. Аналогичные слои из суспензии в NMP после отжига 150–180°С имели сопротивление 200–400 k Ω/\Box .

Более эффективное расслоение элементов суспензии графита в водных и спиртовых растворах по сравнению с широко используемой суспензией в NMP, по-видимому, связано с существенно большей вязкостью раствора в NMP, уменьшающей эффективность центрифугирования. В то же время, согласно данным работы [8], интеркаляция NMP в каждое межслойное пространство частиц графита должна приводить к расслоению при ультразвуковых обработках суспензии, однако результативность этого процесса недостаточно высока. Использование растворов этанола или воды значительно облегчает и ускоряет процесс расслоения. Кроме того, эти суспензии не требуют специальных действий для удаления органической компоненты. Нужно отметить, что, согласно данным работы [9], максимально эффективное расслоение графита наблюдалось для 70%-ного раствора этанола в воде и не наблюдалось вообще в чистых воде и этаноле.

Суспензии графена в водных и спиртовых растворах нестабильны и требуют применения дополнительных добавок или смены раствора при их использовании для 2D-печати. Проблема нестабильности суспензии решалась добавлением этилцеллюлозы и терпинеола либо поверхностно-активных веществ.



Рис. 2. *а* — оптическое изображение края пленки из 20 слоев, напечатанной на подложке SiO₂/Si. Печать проводилась на струйном принтере Epson Status Photo R220, адаптированном для печати графеновыми чернилами на подложках SiO₂/Si. Вставка — рельеф поверхности, измеренный с помощью ACM вблизи края напечатанного слоя. Горизонтальные линии на вставке — аппроксимация средней высоты для пленки и подложки для определения толщины пленки. Вертикальная стрелка — перепад высоты при переходе от подложки на пленку. *b* — ACM-изображение пленки этой же пленки.

Рассмотрим первый вариант стабилизации суспензии на основе этанола и использования ее для печати, а именно добавление этилцеллюлозы и терпинеола. Добавление этилцеллюлозы препятствует слипанию графеновых частиц, терпинеол обеспечивает требуемую вязкость чернил. На рис. 2 представлены оптическое и АСМ-изображения пленки из 20 напечатанных слоев, толщину этой пленки можно оценить как ~ 17 nm (перепад высоты на вставке рис. 2, *a*). Для удаления этилцеллюлозы и терпинеола из напечатанных слоев был проведен отжиг при температуре 400°С в течение часа в атмосфере аргона с водородом. При этом толщина пленки уменьшилась до ~ 5 nm. После отжига было измерено сопротивление слоя, оно составило $30 \,\mathrm{M}\Omega/\Box$, что соответствует удельному сопротивлению 15 Ω · ст. Это более чем на 3 порядка выше, чем сопротивление графена. Высокое сопротивление напечатанных слоев, скорее всего, обусловлено малой толщиной и рыхлой структурой пленки, которая сформировалась, как следует из данных АСМ, после удаления органических добавок при отжиге.

Наиболее интересный вариант чернил получился при использовании добавок поверхностно-активных веществ к суспензиям графена на основе воды. На рис. 3, *a* (кривая *I*) представлена вольт-амперная характеристика, измеренная на полосках с толщиной ~ 6 nm, полученных из суспензии на водной основе, слоевое сопротивление в этом случае составило ~ $12 \text{ k}\Omega/\Box$. Для более толстых слоев (8–12 nm) сопротивление уменьшалось до ~ $4-5 \text{ k}\Omega/\Box$ (рис. 3, *a*, кривая *2*). Слои толщиной 4 nm имели сопротивление ~ 570 kΩ. Передаточная характеристика для полоски толщиной 12 nm в транзисторной структуре, полученной с использованием кремниевой подложки в качестве затвора, представлена на рис. 3, *b*. Схема измерения приведена на вставке рисунка. Подвижность носителей в этом случае составила 50 cm²/V · s для дырок и $40 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ для электронов. Для более тонких слоев (6–8 nm) подвижность уменьшалась до $10-30 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$.

Таким образом, показано, что относительно кратковременная обработка суспензии графита на основе воды и этанола (со специальными добавками) ультразвуком в сочетании с центрифугированием позволяет расслоить частицы суспензии до толщин 0.4–6 nm. Расслаивание происходит более эффективно по сравнению с суспензией в органическом растворителе N-метилпирролидоне, где типичные толщины частиц при аналогичной обработке составляли 6–10 nm. При этом проводимость суспензии на водной и спиртовой основе оставалась достаточно вы-



Рис. 3. a — вольт-амперная характеристика, измеренная на полоске с толщиной ~ 6 nm (1) и 12 nm (2). b — передаточная характеристика для полоски толщиной 12 nm в транзисторной структуре, полученной с использованием кремниевой подложки в качестве затвора. Контакты были сделаны серебряной пастой, измерения проводились с использованием пикоамперметра Keithley 6485. На вставках приведена схема измерения.

сокой, слоевое сопротивление пленок толщиной около 100–200 nm составило 170–210 Ω/\Box . Замена жидкой компоненты чернил на терпинеол с добавлением этилцеллюлозы позволила получить стабильную суспензию для 2D-печати. Однако слои, напечатанные такими чернилами, требуют относительно высокой температуры отжига для удаления органических добавок (400°C) и обладают высоким сопротивлением получаемых слоев. Лучший результат по проводимости пленок был получен при печати из суспензий на водной и спиртовой основе с добавлением поверхностно-активных веществ. В этом случае для пленок толщиной 6–12 nm получено слоевое сопротивление 12–5 k Ω/\Box , а подвижность носителей в них составила 30–50 cm²/V·s.

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда, № гранта 15-02-00008.

Список литературы

- [1] Kamyshny A., Magdassi S. // Small. 2014. V. 10. P. 3515.
- [2] Li J., Lemme M.C., Östiling M. // Chem. Phys. Chem. Concepts. 2014. V. 15. P. 3427.
- [3] Withers F., Yang H., Britnell L. et al. // Nano Lett. V. 14. N 7. P. 3987.
- [4] Eda C., Chhowalla M. // Adv. Mater. 2010. V. 22. P. 2392.
- [5] Zhang M., Parajuli R.R., Mastrogiovanni D. // Small. 2010. V. 6. P. 1100.
- [6] Secor E.B., Prabhumirashi P.L., Puntambekar K. et al. // J. Phys. Chem. Lett. 2013. V. 4. P. 1347.
- [7] Parvez K., Wu Z.-S., Li R. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2014. V. 136. P. 6083.
- [8] Hernandez Y., Nicolosi V., Lotya M. et al. // Nature Nanotechnol. 2008. V. 3. P. 563.
- [9] Liu W.-W., Xia B.-Y., Wang J.-N. // Front. Mat. Sci. 2012. V. 6. P. 176.